窒素ドープ酸化ガリウム薄膜における青色発光の強度変化 Intensity Changes of Blue Luminescence in N-doped β-Ga₂O₃ Epitaxial Films 工学院大¹, 情通機構², タムラ製作所³, ⁰尾沼 猛儀^{1,2}, 中田 義昭², 佐々木 公平^{3,2}, 増井 建和³, 山口 智広¹, 本田 徹¹, 倉又 朗人³, 山腰 茂伸³, 東脇 正高² Kogakuin Univ.¹, NICT², Tamura Corp.³, ^oT. Onuma^{1,2}, Y. Nakata², K. Sasaki^{3,2}, T. Masui³, T. Yamaguchi¹, T. Honda¹, A. Kuramata³, S. Yamakoshi³, and M. Higashiwaki² E-mail: onuma@cc.kogakuin.ac.jp

[はじめに] 我々はこれまでβ-Ga₂O₃ 基板の光学的特性を中心に、その材料物性を調査してきたが、 中でも、発光特性は不純物や真性欠陥準位に関する情報やキャリア再結合に関する情報などを得 る手法として非常に有用である。これまでに、青色発光強度と抵抗率の相関を見出し、酸素空孔 (V₀)が青色発光に関与することを明らかにしてきた[1]。また、前回の講演会では、Si ドープ単結 晶基板の発光特性を調査し、高濃度に Si がドープされた試料では、自己トラップ励起子がデバイ 遮蔽され、Si ドナーが関与する DAP 発光が観測されることなどを提案した[2]。本講演では、窒素 ドープされたエピタキシャル薄膜のカソードルミネセンス(CL)スペクトルを測定した結果を報告 する。

[実験] (010) β-Ga₂O₃ 基板上に RF-MBE 法により成長した 100-750 nm 厚のエピタキシャル薄膜 の測定を行った。酸素流量の変化により薄膜への窒素の取り込み量が変化した。SIMS 測定より窒 素濃度は、[N]=7×10¹⁶~1×10¹⁸ cm⁻³ と見積もられた。窒素ドープにより薄膜が高抵抗化することを 確認し[3]、既に縦型 MOSFET の電流狭窄層として機能することも確認している[4]。

[結果と考察] 図に CL スペクトルの温度依存性を示す。低濃度に窒素がドープされた試料[図(a)] では、これまでの報告[1]と同様に、バンド端発光は観測されず、極低温では 3.2~3.6 eV の紫外線 発光帯(UVL)、室温付近では 2.5~3.0 eV の青色発光帯(BL)が観測された。一方、高濃度に窒素がドープされた試料[図(b)]では、室温付近での青色発光が抑制され、UVL が支配的に観測された。得

られた結果は、窒素ドープによる Vo 濃度の減少を示 唆している。Voはイオン化エネルギーが1 eV 程度[5] と大きく活性化率は低いが、ガリウム空孔(VGa)や関連 する複合欠陥などのアクセプター型の真性欠陥を補償 し、Si などのドナー不純物の活性化に寄与することが 報告されている[6]。これに従うと Vo 濃度の減少によ り、VGa などのアクセプター型欠陥が Si などのドナー 不純物を補償し高抵抗化することが類推されるが、窒 素ドープによる薄膜の高抵抗化[3,4]と矛盾しない。 [参考文献]

[1] T. Onuma *et al.*, APL **103**, 041910 (2013). [2] 第 78
回応用物理学会秋季学術講演会 7p-C17-10 (2017).
[3] T. Kamimura *et al.*, IWGO2, Parma, Italy, Sep. 13 (2017), No. O2. [4] M. H. Wong *et al.*, 59th Electornic Materials Conference, Indiana, Jun. 28 (2017), No. A3. [5] J. B. Varley *et al.*, APL **97**, 142106 (2010). [6] E. Korhonen *et al.*, APL**106**, 242103 (2015).

Wavelength (nm)



Figure Temperature-dependent CL spectra of (010) N-doped β -Ga₂O₃ epitaxial films grown by RF-MBE with nitrogen concentrations [N] of (a) 7×10¹⁶ and (b) 1×10¹⁸ cm⁻³.